

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成19年9月13日(2007.9.13)

【公表番号】特表2003-506571(P2003-506571A)

【公表日】平成15年2月18日(2003.2.18)

【出願番号】特願2001-515338(P2001-515338)

【国際特許分類】

C 21 D 9/56 (2006.01)

【F I】

C 21 D 9/56 101 G

【手続補正書】

【提出日】平成19年7月24日(2007.7.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 材料の支持が、熱処理炉の開口に近接して該炉の外部に設置された支持要素により行なわれ、該支持要素の相対位置が支持装置の駆動機構により調整可能なように可動的に設置された少なくとも二つの支持要素を含む、連続的に運転される前記熱処理炉内で処理される前記材料の支持装置において、少なくとも一つのガス制御要素が、前記支持要素の支持に使用されるハウジング要素に対して設置されており、該ガス制御要素は、前記材料の処理に使用されるガスが前記支持要素と該制御要素との間を流れることを可能にし、該制御要素は同時に前記熱処理炉のシーリングの一部を構成していることを特徴とする支持装置。

【請求項2】 請求項1に記載の支持装置において、前記制御要素は二つのシーリング要素の間に設置され、これにより、前記支持される材料の流れの方向と実質的に平行に、かつ該支持される材料の下方で、前記支持要素と前記制御要素との間を流れるようにガスを方向付けることを前記シーリング要素が可能にすることを特徴とする支持装置。

【請求項3】 請求項1または2に記載の支持装置において、前記制御要素間に、中間支持要素が設置されていることを特徴とする支持装置。

【請求項4】 請求項1、2または3に記載の支持装置において、前記制御要素と前記シーリング要素との間に、前記中間支持要素が設置されていることを特徴とする支持装置。

【請求項5】 請求項1から4までのいずれかに記載の支持装置において、前記制御要素の表面の部分と前記支持要素の表面の部分が同一の円の円周の一部を形成することを特徴とする支持装置。

【請求項6】 請求項1から5までのいずれかに記載の支持装置において、前記制御要素は実質的にその表面全体が曲形状にされていることを特徴とする支持装置。

【請求項7】 請求項1から6までのいずれかに記載の支持装置において、該支持装置の前記支持要素は流通形冷却剤循環路を備えていることを特徴とする支持装置。

【請求項8】 請求項1から7までのいずれかに記載の支持装置において、該支持装置の前記制御要素は流通形冷却剤循環路を備えていることを特徴とする支持装置。

【請求項9】 請求項1から8までのいずれかに記載の支持装置において、該支持装置の前記シーリング要素は流通形冷却剤循環路を備えていることを特徴とする支持装置。